

Aufgabe

Herstellung von Dünnschichten auf Foliensubstraten und Bändern durch Sputterprozesse

Technische Daten

Targets:

- 3 x DC Magnetron (12,5 x 40 cm)
- 1 x RF Magnetron

Auch Reaktivprozesse über integrierte Gasdusche möglich

Generatoren:

- Advanced Energy 5 kW dual DC (Pinnacle Plus)
- Hüttinger 3 kW RF (Quinto 3013)

Substrataufnahme:

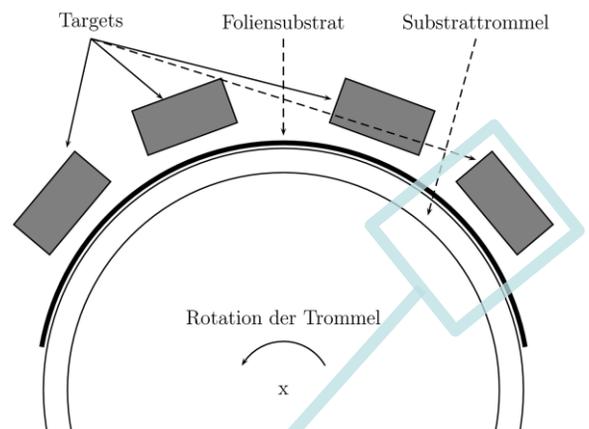
- Trommel mit 2,85 m Umfang
- Substratbreite bis max. 40 cm
- Heizbar bis 250° C

Funktionsweise

Anlage im geöffneten Zustand



Schematischer Aufbau



Schema des reaktiven Sputterprozesses

